

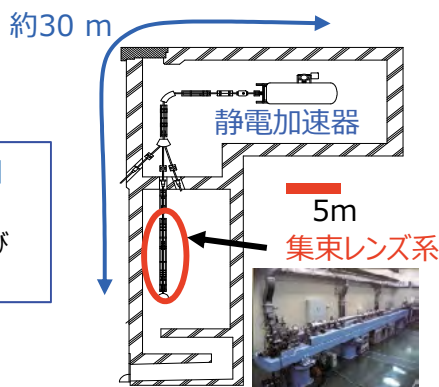
91 小型イオンマイクロビーム装置

従来技術では30m程度の大型装置でしか形成できなかった数100keV～数MeVのイオンマイクロビームを2m×2m×2m程度の小型装置で形成する。

シーズの特徴（成果含む）

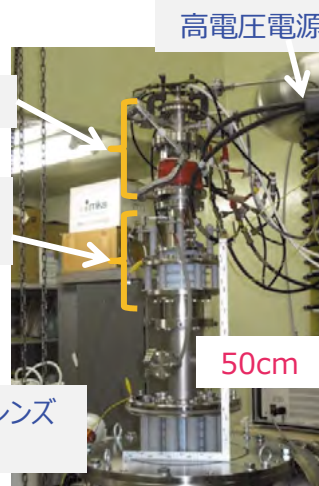
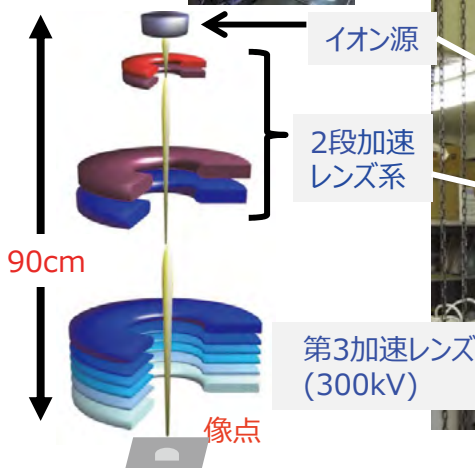
従来のイオンマイクロビーム技術

（加速器、ビームライン及び集束レンズが必要）

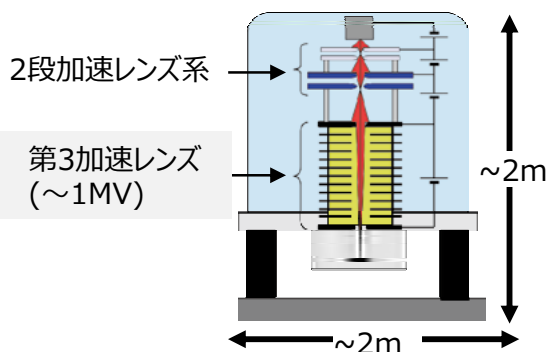


例）高崎量子応用研究所
軽イオンマイクロビーム装置

小型イオンマイクロビーム装置：プロトタイプ、
～300keVで実現
（3段加速レンズで大幅に小型化）



MeV小型イオンマイクロビーム装置の概念図
（1MeVを目標）



アウトカム

微細加工・分析装置の開発

アウトカムに至る段階

基礎

連携希望企業

微細加工・分析機器分野の企業

知財等関連情報

- 1) 特許 第4665117号
- 2) 特許 第5971631号

担当者

量子科学部門
高崎量子応用研究所放射線高度利用施設部ビーム技術開発課
石井 保行

本シーズの問合せ先：量子ビーム科学部門研究企画部 (qubs-techoffice@qst.go.jp)